

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

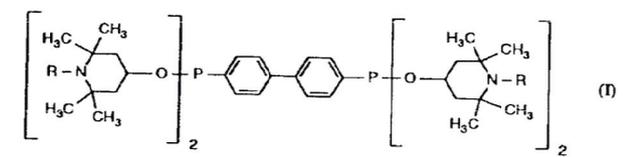
(51) Int. Cl. ⁵ C07F 9/32	(11) 공개번호 특 1994-0007049
	(43) 공개일자 1994년 04월 26일
(21) 출원번호	특 1993-0019742
(22) 출원일자	1993년 09월 23일
(30) 우선권주장	92-8/3008 1992년 09월 25일 스위스(CH)
(71) 출원인	시바-가이키 아게 베르너 발데크 스위스연방 4002 바젤 클라이벡스트라세 141
(72) 발명자	리타 피테로우드
	스위스연방 1724 프라로만 수르 레 빌라게
(74) 대리인	강재현, 이병문, 이태희

심사청구 : 없음

(54) 테트라-[N-알킬-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘-4-일]-4,4'-디페닐비스포스포나이트 및 이를 함유하는 조성물

요약

하기 일반식 (1)의 신규 화합물은 열적, 산화적 또는 광유도 분해로부터 유기물질을 보호하기 위한 안정화제이다.



상기 식에서, R은 C₁-C₄알킬, 알릴 또는 벤질임.

명세서

[발명의 명칭]

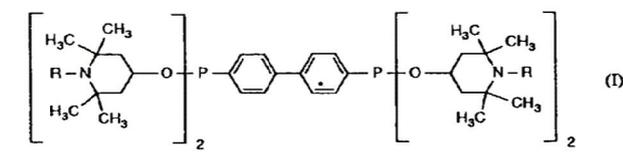
테트라-[N-알킬-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘-4-일]-4,4'-디페닐비스포스포나이트 및 이를 함유하는 조성물

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

하기 일반식 (1)의 화합물:



상기 식에서, R은 C₁-C₄알킬, 알릴 또는 벤질임.

청구항 2

제1항에 있어서, R이 메틸 또는 벤질인 화합물.

청구항 3

a) 산화적, 열적 또는 광유도 분해되기 쉬운 유기물질, 및 b) 한개 이상의 제1항에 따른 일반식 (1) 화합물을 포함하는 조성물.

청구항 4

제3항에 있어서, 성분(a) 및 (b) 이외에 다른 첨가제를 포함하는 조성물.

청구항 5

제4항에 있어서, 다른 첨가제가 페놀성 산화방지제, 광 안정화제 및 가공 안정화제로 구성된 군으로부터 선정되는 조성물.

청구항 6

제5항에 있어서, 벤조푸란-2-온 및/또는 입체장애 페놀 유형의 화합물중 한개이상을 첨가제로서 포함하는 조성물.

청구항 7

제3항에 있어서, 성분(a)가 천연, 반합성 또는 합성 중합체인 조성물.

청구항 8

제7항에 있어서, 성분(a)가 열가소성 중합체인 조성물.

청구항 9

제8항에 있어서, 성분(a)가 폴리올레핀인 조성물.

청구항 10

제9항에 있어서, 성분(a)가 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌인 조성물.

청구항 11

안정화제인 제1항에 따른 일반식(1)의 화합물을 유기물질에 혼입 또는 부가하는 것을 포함하는, 산화적, 열적 또는 광유도 분해로부터 유기물질을 보호하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.